

溅射系统

NANO-MASTER最先进的全自动溅射系统带有水冷或者加热(最高可加热到700度)功能的8"旋转样平台,最大可支持到3个偏轴平面磁控管。系统配套涡轮分子泵,极限真空可达 10^{-7} Torr。

通过使用RF射频开关,RF射频或DC直流电源可以切换到多磁控管模式。通过调整磁控管与基片之间的距离,可以获得想要的均匀度和沉积速度。带有偏轴磁控管的旋转样品台,提供了最佳的薄膜均匀性。晶振式厚度监测仪提供了系统可以自动终止工艺的能力;

产品特点:

- >>不锈钢, 铝质腔体, 或钟罩式玻璃腔体
- >>70, 250或500L/S涡轮分子泵配套机械泵或干泵使用
- >>13.56MHz, 300-600W RF射频电源及1KW DC直流电源
- >>晶振探头的厚度分辨率小于1埃
- >>带观察视窗的腔门易于放置/取出晶片
- >>通过LabVIEW软件实现PC计算机控制
- >>多级访问密码保护
- >>完全地安全联锁功能

选项:

- >>向上, 向下或侧面溅射方式可选
- >>支持RF, DC以及脉冲直流溅射
- >>支持共溅射, 反应溅射
- >>支持组合方式溅射
- >>RF或DC偏压(1000V)
- >>样片台可加热到700摄氏度
- >>带膜厚监测仪
- >>基片RF射频等离子清洗
- >>预真空锁及晶圆自动装/卸载功能

应用:

- >>晶圆片, 陶瓷片, 玻璃片, 磁头等的金属和介质涂层
- >>光学和ITO涂层
- >>高温样品台加脉冲直流电源实现硬涂层
- >>带RF等离子放电的反应溅射

型号:

- NSC-4000 基于PC控制的柜式独立系统
- NSC-3500 基于PC控制的紧凑型柜式独立系统
- NSC-3000 基于PC控制的台式系统
- NSC-1000 派热克腔体/1个2"磁控管/直流电源/适合SEM应用和溅射金属

双系统:

- NSR-4000 溅射和RIE反应离子刻蚀系统
- NSP-4000 溅射和PECVD系统
- NST-4000 溅射和热蒸发系统



NSC-4000



NSC-3500



NSC-1000